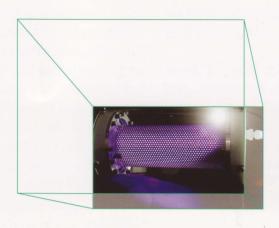
## **ARIOS**





# **Corporate Profile**

www.arios.jp

### **Vacuum & Plasma Equipment**



当社は、1972年創業以来、真空機器、研究開発 機器の設計製造販売を主体として発展してまいり ました。

常に新しい技術への挑戦を続け、確かな実績を残 してきたと自負しております。私達の仕事は、お客 様のイメージを具体的な形にしていくこと、また、 新しい技術を提案していくことと考え、今後も「超 高真空技術、半導体技術を中心に先端技術分野にお いて社会に貢献する」をモットーに努力してまいり

これからも、一層のご指導お引き立てを賜ります ようお願い申し上げます。

Since our foundation in 1972 we have carried out our determination to continue the designing and manufacture of vacuum apparatus and have exerted further efforts into such research and development.

Our challenge is always aimed at new technology and this is our goal. The results achieved so far reflect this self-confidence of our purpose. Our work is to dedicate ourselves and realize in a concrete form the wishes of our customer's image. Moreover, when a new technology is proposed to us, it will be our motto from then on to do our very best succeed in that High-Tech field and contribute to this society focusing specifically on Ultra-High Vacuum Technology and Semi-Conductor Technology.

We solicit your guidance, backing and cooperation to achieve the best result.

### Planning to After-Service

#### **PLANNING**

機械・電気の専門スタッフがあら ゆるニーズにお応えします。

Our mechanical/ electrical engineers will respond to your every expectations.



#### DESIGNING

CAD を駆使しアイデアを最適な 形にします。

Our designing team has a very high command of the latest CAD information and will embody any new idea in its optimal form.



#### **MANUFACTURING**

クリーンな環境で入念に組み立 てます。

Our manufacturing division is carefully assembled in a clean environment.



社内調整から現地調整まで、専門 のスタッフが完璧に仕上げます。

INSPECTION/COORDINATE

Dispatch of the finished goods will be organized and supervised by our competent staff.



一貫した体制により、あらゆるト ラブルに速やかに対応します。

Under our guaranty period conditions, we will try to resolve all problems / troubles promptly.



### |真空装置のメンテナンス、改造等何でもご相談下さい

特に、装置排気系改造、手動装置の自動化等に多くの実績があります 国内メーカー、海外メーカーのほとんどに対応可能です

### プラズマ製品 / Plasma Unit / Apparatus



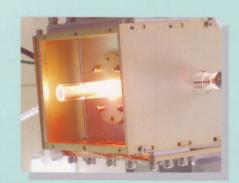
プラズマ源 (マイクロ波·RF) / Plasma Source/(Microwave,RF)



ラングミュアプローブユニット/Langmuir Probe Unit



プラズマ実験装置/Plasma Experimental System



大気圧プラズマ源/Atmospheric Plasma Source

### システム、装置/Vacuum System, Apparatus



超高真空小型排気装置/UHV Exhaust System



強誘電体成膜用MO-CVD装置/MO-CVD System



各種MBE装置/MBE System



プラズマCVD装置/Plasma CVD System

### MBE関連ユニット/MBE Units



各種分子線セル、700W加熱電源/K-Cell, Power Supply



R-HEEDシステム/R-HEED System



ビームフラックスモニター/Beam Flux Monitor



EB蒸着源ユニット/Miniature Evaporation Unit

### 真空コンポネンツ / Components



ロードロックハッチ/Load Lock-Door



簡易型XY機構/Compact XY Stage



回転導入機/Rotary Motion





異径キューブ/Cube



VPシャッター/VP Shutter

商 号 アリオス株式会社

代表取締役/工学博士

有屋田修

設 立 1972年8月

資本金 1500万円

所在地 〒196-0021

東京都昭島市武蔵野3-2-20 TEL 042-546-4811 FAX 042-546-4814 http://www.arios.co.jp/

当社は、空気の研究を支援するところから始まり、現在は、真空技術をベースにプラズマやイオンなどを利用した高度な技術に挑戦しています。 ARIOSは、そのことを表わしています。

空気の精 ARIEL 空気、真空を科学するイメージ + 太陽神 HELIOS 太陽は究極のプラズマ ARIOS

#### 沿革

1972年 研究用機器の設計、製造、販売を主体 として大誠産業株式会社を東京都調布 市に設立 1980年 水素メーザー原子周波数標準器量子系 開発 1985年 MBE装置関連事業開始 1988年 昭島市中神町に工場新設 1990年 超高真空スパッタ装置開発 資本金1500万円に増資 1993年 昭島市武蔵野に本社、工場を移転統合 RFラジカル源、R-HEEDシステム開発 マイクロ波イオン、ラジカル源開発 1994年 1995年 CVD装置関連事業開始 1997年 R-HEED画像処理ソフト開発 電離真空計に関する特許取得 2000年 2001年 アリオス株式会社に改名 東京都の中小企業経営革新計画承認 昭島市武蔵野3-2-20に移転し、フ 2002年 ロアー拡大 2003年 大気圧プラズマ源の開発 2004年 ISO14001認証取得 2005年 子会社(有)スプリード設立

#### 主な取引先 (順不同)

#### ■ 企業

キヤノン株式会社/キャノンアネルバ株式会社/シャープ株式会社/株式会社島津製作所/住友重機械工業株式会社/住友電気工業株式会社/日本電気株式会社/日本電子株式会社/株式会社リョーサン/他多数

#### ■官公庁

気象研究所/産業技術総合研究所/情報通信研究機構/超先端電子技術開発機構/物質·材料研究機構/理化学研究所/他多数

#### ■大 学

大阪大学/岡山理化大学/京都大学/電気通信 大学/東京大学/東京工業大学/同志社大学/ 東北大学/北海道大学/室蘭工業大学/他多数

#### 取引銀行

東京三菱銀行立川支社・昭島支店/りそな銀行昭島支店/商工組合中央金庫八王子支店/西武信用金庫

NAME ARIOS INC.

PRESIDENT Dr. OSAMU ARIYADA

ESTABLISHED JULY, 1972

CAPITAL ¥15,000,000

**ADDRESS** 

2-20,MUSASHINO 3CHOME, AKISHIMA, TOKYO 196-0021 JAPAN URL http://www.arios.co.jp/

In few years ago, our staff named company logo Arios. ARIOS was made from Ariel (a prankish spirit in shakespeare's The Tempest. Spirit of air) and Helios (the god of sun in Greek mythology.The sun is ultimate plasma). Our work was started to support the study of atmosphere, and now, is challenging high technology by plasma and ion etc. Arios shows this concept.

#### HISTORY

1972 TAISEI INDUSTRY was established to CHOFU city, Tokyo also for the purpose of the designing apparatus for research, manufacture and sale.

1980 Development of the Hydrogen Maser

1985 The starting of MBE associated business.

1988 Its factory is newly established in NAKAGAMI-CHO, AKISHIMA city 1990 UHV sputter system is developed

1990 UHV sputter system is developed 1991 Increase of its capital to 15,000,000 Yen.

1993 The head office and a factory are moved together to MUSASHINO, AKISHIMA-city. RF radical source, R-HEED system are developed.

1994 Development of Microwave ion, radical source.

1995 Starting of CVD associated business.

1997 R-HEED Image-Processing Software is developed.

2000 Patent acquisition of ION GAUGE

2001 Recognition of the enterprises management plan of Tokyo is received.

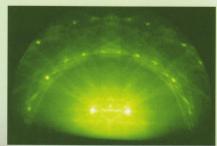
Company name is changed to ARIOS INC.

2002 Company moves to 3-2-20 MUSASHINO, AKISHIMA city and floor is expanded.

2003 Development of the source of Atmospheric Plasma

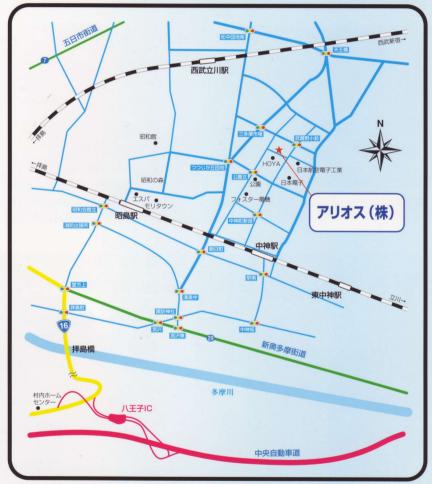
2004 ISO 14001 certification is acquired.

2005 SPLEAD Ltd, a wholly-owned subsidiary of ARIOS INC is established.



## **ARIOS**





[交通機関] 『電車』 JR青梅線、中神駅北口下車徒歩15分/西武拝島線、西武立川駅下車徒歩約20分 『自動車』 中央自動車道、八王子インターより拝島橋経由、約20分

(byTrain) JR Ome Line Nakagami station north entrance alighting on foot 15 minutes. (by Car) It is about 20 minutes via the Haijima bridge from the Chuo Expressway Hachioji interchange.

ARIOS INC.

## アリオス株式会社

2-20,MUSASHINO 3CHOME,AKISHIMA, TOKYO 196-0021 JAPAN

TEL: 042-546-4811 FAX: 042-546-4814 〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-2-20 http://www.arios.co.jp/